

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

Attorney Docket
1796-157

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2001年 2月13日

出 願 番 号
Application Number:

特願2001-036083

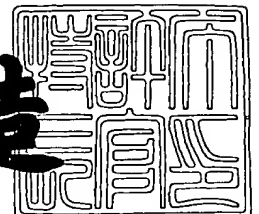
出 願 人
Applicant(s):

帝人製機株式会社

2001年 3月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3013200

【書類名】 特許願

【整理番号】 P1370

【提出日】 平成13年 2月13日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01L 21/304

【発明者】

【住所又は居所】 三重県津市片田町字壱町田 5 9 4 番地 帝人製機株式会社
社津工場内

【氏名】 王 宏猷

【発明者】

【住所又は居所】 三重県津市片田町字壱町田 5 9 4 番地 帝人製機株式会社
社津工場内

【氏名】 川嶋 航治

【特許出願人】

【識別番号】 000215903

【氏名又は名称】 帝人製機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100082681

【弁理士】

【氏名又は名称】 三中 英治

【選任した代理人】

【識別番号】 100077654

【弁理士】

【氏名又は名称】 三中 菊枝

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000- 86061

【出願日】 平成12年 3月27日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007124

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【物件名】 図面 1

【包括委任状番号】 9814925

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポリッシング装置の回転駆動装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体のウエーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いるポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置において、外接軸および該外接軸の周囲に等配的に配置されて該外接軸に外接する複数の中間軸からなるトラクションドライブ減速機を用いて前記ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャに回転を伝達することを特徴とするポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 2】 前記トラクションドライブ減速機が、リング状の中空円筒からなり中心に配設された外接軸、該外接軸の周囲に等配的に配置されて該外接軸に外接するとともに少なくとも 1 本が入力軸となっている複数の中間軸、および該中間軸が内接する内接円筒からなり、前記中空円筒外接軸は自由状態の外径が複数の中間軸に外接する円の直径より若干大きく形成されていて該中空円筒の変形によって圧接荷重を発生するようになっていることを特徴とする請求項 1 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 3】 前記内接円筒が同心状の二重中空リングからなり、該二重中空リングの内側リングと外側リングとが連結部材により連結されていることを特徴とする請求項 2 に記載のトラクションドライブ式駆動装置。

【請求項 4】 前記内接円筒が前記ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャにピンまたはキーにより連結されていることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 5】 前記内接円筒が主軸受の内輪となっていることを特徴とする請求項 2、3 または 4 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 6】 前記主軸受が 2 列のアンギュラ玉軸受からなり、該主軸受の外輪がポリッシング装置のハウジングに一体化されていることを特徴とする請求項 5 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 7】 前記入力軸に電気モータが連結されており、該入力軸が前記外接軸の中心から該電気モータの半径より大きくオフセットしていることを特徴

とする請求項 2 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 8】 前記トラクシヨンドライブ減速機が、中心に配設されるとともに入力軸となっている外接軸、該外接軸の周囲に等配的に配置された複数の中間軸、該中間軸が内接する内接円筒および前記中間軸を回転支持するキャリアからなり、該キャリアまたは内接円筒から出力を取出すようになっていることを特徴とする請求項 1 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 9】 前記外接軸が前記ポリッシングテーブル、CMP 用テーブルまたはポリッシャの回転中心から偏心して設けられ、前記キャリアに連結された出力軸が前記外接軸の軸線上に設けられており、該出力軸が動力伝達部材により前記ポリッシングテーブル、CMP 用テーブルまたはポリッシャに連結されていることを特徴とする請求項 8 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【請求項 10】 前記入力軸となっている外接軸に電気モータが連結されていることを特徴とする請求項 9 に記載のポリッシング装置の回転駆動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は、ポリッシング装置の回転駆動装置に関する。より詳しくは、本発明は、半導体のウエーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いるポリッシングテーブル、CMP（化学的機械的ポリッシング）用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

半導体ウエーハ等の平坦化には CMP（化学的機械的ポリッシング）と言う工法がよく用いられる。簡略的に説明すると、ウエーハを回転テーブルに載置し、ポリッシャによりウエーハを回転テーブルに押し付け、ウエーハと回転テーブルの間に散布したスラリーを介してポリッシングするのである（例えば、特開平 8 - 1 6 7 5 8 5 号公報参照）。

【0003】

低振動、低騒音でこの回転テーブルおよび／またはポリッシャを回転駆動する

必要があり、このために、低速回転のダイレクト駆動モータ（DDモータという）がよく使用されている。すなわち、回転テーブルの中心部の駆動軸をDDモータの出力軸と連結する。しかし、従来のDDモータ方式の場合は、非常に大きく、重いという問題があった。

【0004】

加えて、ウエーハサイズの増大（例えば8インチから12インチに）により、テーブルの駆動には一層大きいトルクを必要とする。このため、その問題は更に深刻化する。すなわち、DDモータは大きなトルクを得るため、モータの体積と重量が大きくなり、必要な電流も大きくなって発熱が増大する。

【0005】

一方、CMPではウエーハに高い品位の平坦度を得るため、テーブルの回転速度の変動と振動を厳しく抑えることが重要な課題である。しかし、一般にモータ変動の絶対値はほぼ決まっており、モータ速度の変動率はモータ速度に対する変動の割合であるので、モータ速度が低いDDモータにあっては速度の変動率を小さく抑えることが困難である。

【0006】

これに対して、高速モータとギヤ減速機を使用して駆動装置の小型化を図るとともに速度の変動率を低減する試みもある。例えば、回転テーブルの中心部から駆動軸を下向きに設け、この駆動軸に形成した歯車と駆動モータの出力に取着した歯車を噛合させて、回転テーブルを回転駆動する（例えば、実開昭62-78260号公報参照）。しかし、ギヤ減速機の歯と歯の噛み合いのために、比較的大きな振動と騒音が発生するという問題が生じる。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、CMPテーブル等の駆動装置は、ウエーハの大口径化により、必要とするトルクも大きくなる。一方、半導体ウエーハ等のポリッシング装置は、クリーンルーム内で使用するため、クリーンルーム床の耐荷重制限から装置の軽量化が要求される。

【0008】

また、ウエーハを高精度に平坦化するため、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの回転には高い回転精度（回転速度の変動、振動、テーブルの面フレが小さいこと）が厳しく要求される。

【0009】

更に、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの温度を制御するため、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャが中空構造であることとともに低発熱であることが必要とされる。

【0010】

【発明の目的】

本発明は上述した要求を同時に満たすことができるポリッシング装置の回転駆動装置、すなわち、ポリッシングテーブル、CMP（化学的機械的ポリッシング）用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置を提供することを目的とする。

【0011】

より詳しくは、本発明は、大きな出力トルクと高い回転速度精度を有し、且つ、低振動、低騒音で、更に中空であるコンパクトで、軽量のポリッシング、CMP用テーブルまたはポリッシャの駆動装置を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明においては、半導体のウエーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いるポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置において、外接軸および外接軸の周囲に等配的に配置されて外接軸に外接する複数の中間軸からなるトラクションドライブ減速機を用いてポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャに回転を伝達することを特徴とするポリッシング装置の回転駆動装置により、上記の目的を達成する。

【0013】

より詳しくは、本発明は、実施例に示すように、トラクションドライブ減速機が、リング状の中空円筒からなり中心に配設された外接軸、外接軸の周囲に等配的に配置されて外接軸に外接するとともに少なくとも1本が入力軸となっている複数の中間軸、および中間軸が内接する内接円筒からなり、中空円筒外接軸は自

由状態の外径が複数の中間軸に外接する円の直径より若干大きく形成されていて中空円筒の変形によって圧接荷重を発生するようになっていることを特徴とするポリッシング装置の回転駆動装置とすることが好ましい。

【 0 0 1 4 】

この場合に、内接円筒が同心状の二重中空リングからなり、二重中空リングの内側リングと外側リングとが連結部材により連結されていることが好ましい。すなわち、内接円筒は外周に複数の凹部を有しており、該凹部に装着したころを介して二重中空リングの外側リング（出力軸）に一体的に係合している。これにより、真円であった浮動リング（中空リング状内接円筒）の形状は、その弾性域において波状に変形して圧接力を発生し、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの回転には高い回転精度（回転速度の変動、振動、テーブルの面フレが小さいこと）が達成でき、ウエーハを高精度に平坦化することができる。

【 0 0 1 5 】

更に、本発明においては、実施例に示すように、内接円筒がポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャにピンまたはキーにより連結されていることが好ましい。より具体的には、内接円筒が主軸受の内輪となっており、主軸受が2列のアンギュラ玉軸受からなり、主軸受の外輪がポリッシング装置のハウジングに一体化されていることが構造がコンパクトとなり、クリーンルーム床の耐荷重制限にたえ、クリーンルーム内で使用する半導体ウエーハ等のポリッシング装置として、軽量化が達成でき好ましい。

【 0 0 1 6 】

更に、本発明においては、実施例に示すように、入力軸に電気モータが連結されており、入力軸が外接軸の中心から電気モータの半径より大きくオフセットしていることにより、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャを中空構造とでき、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの温度を制御することができる。

【 0 0 1 7 】

また、別の実施例に示すように、本発明は、中心に配設されるとともに入力軸

となっている外接軸、外接軸の周囲に等配的に配置された複数の中間軸、および中間軸が内接する内接円筒からなり、中間軸または内接円筒から出力を取出すようになっているポリッシング装置の回転駆動装置としてもよい。。

【0018】

この場合に、外接軸がポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャの回転中心から偏心して設けられ、複数の中間軸を回転可能に具備した出力軸が外接軸の軸線上に設けられており、出力軸が前記ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャに動力伝達部材により連結されていることが好ましい。動力伝達部材としては歯付きベルト等を用いることができる。また、入力軸となっている外接軸には電気モータが連結されていればよい。

【0019】

前述したように、DDモータは大きなトルクを得るため、モータの体積と重量が大きくなり、必要な電流も大きくなって発熱が増大する。これに対して、本発明によれば、高速モータ（1000rpm以上）を使用し、特殊構造の減速機を介して出力トルクを減速比R倍に拡大して取出すことにより、コンパクトで大トルクを得られる。

【0020】

また、前述したように、ポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャではウエーハの高い品位の平坦度を得るため、テーブルの回転速度の変動と振動を厳しく抑えることが重要な課題である。本発明においては、上述した構成からなる特別の減速機構を用いることにより、この課題を達成することができる。

【0021】

【実施例】

以下、本発明の実施例を図示した図面を参照して本発明を詳細に説明する。図1は、本発明をCMPテーブルに適用した一実施例の断面図であり、図2は図1の2-2断面を示す。

【0022】

図1において、テーブル10は、その上に半導体のウエーハや液晶ガラス等が

載置され、上からポリッシャ（図示せず）で押圧されて、ウェーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いられる。テーブル 1 0 はフレーム 1 1 の上に載置されており、後述するように、トラクションドライブ減速機 2 0 を介して、駆動モータ 1 により水平面内で回転可能である。

【 0 0 2 3 】

本発明に係る回転駆動装置の一実施例を図 2 を参照して説明する。リング状の中空円筒からなる外接軸 5 がキャリア 4（図 1）によってテーブル 1 0 の回転中心位置に配設されている。外接軸 5 の周囲に複数（図 2 では 3 個）の中間軸 2 が等配的に配置されており、図 1 に示すように、軸受 1 3 を介して、キャリア 4 に回転可能に支承されている。各中間軸 2 は、外接軸 5 に外接している。従って、中間軸 2 の各軸心はリング状の中空円筒からなる外接軸 5 の軸心からオフセットしている。このオフセット量は、後述する駆動モータ 1 の半径より大きくしている。

【 0 0 2 4 】

図 1 に示すように、電気モータからなる駆動モータ 1 がボルト 1 4 によりフレーム 1 1 に取着され、駆動モータ 1 の出力軸 1 a は垂直となっている。中間軸 2 のうちの 1 本は、駆動モータ 1 の出力軸 1 a にスプライン（図示せず）結合されており、この中間軸 2 は CMP テーブルの回転駆動力の入力軸となっている。

【 0 0 2 5 】

上述したように中間軸 2 の位置は、駆動モータ 1 の半径より大きくオフセットしており、テーブルの中心部にリング状の中空円筒からなる外接軸 5 が位置しており、テーブル 1 0 の中心部にキャリア 4 により薄肉円筒 1 6 を支持して中空構造としており、この中空部にジョイント 3 を通し、ポリッシングテーブル、CMP 用テーブルまたはポリッシャの温度を制御する。

【 0 0 2 6 】

再び図 2 を参照して、前述した複数の中間軸 2 の外周が、内接円筒 6 の内周面に内接している。本実施例において、内接円筒 6 と同心状の中空リングからなる出力軸 8 が内接円筒 6 の外側に設けられ、内接円筒 6 と出力軸 8 とによって同心状の二重中空リングが構成されている。

【 0 0 2 7 】

二重中空リングの内側リング（内接円筒 6）の外周面と外側リング（出力軸 8）の内周面の対応する位置に多数の凹部が形成され、内側リング（内接円筒 6）と外側リング（出力軸 8）との間の凹部に多数のころ 1 2 が連結部材として装着されている。従って、内側リング（内接円筒 6）と外側リング（出力軸 8）とはころ 1 2 により連結されており、内側リング（内接円筒 6）の半径方向の変形を許容するとともに、回転に対しては内側リング（内接円筒 6）と外側リング（出力軸 8）からなる二重中空リングは一体となっている。

【 0 0 2 8 】

ここに、リング状の中空円筒からなる外接軸 5 は特別な支持ベアリングを設けることなく複数の中間軸 2 によって保持されて浮動リングとなっている。そして、中空円筒外接軸 5 は自由状態の外径が複数の中間軸 2 に外接する円の直径より若干大きく形成されていて、中空円筒外接軸 5、中間軸 2 および内接円筒 6 の組み込み状態において、中空円筒外接軸 5 および内接円筒 6 の変形によって圧接荷重を発生するようになっている。

【 0 0 2 9 】

二重中空リングの外側リング（出力軸 8）は主軸受の内輪となっており、ケース 1 7 が主軸受の外輪となっている。従って、外側リング（出力軸 8）、ケース 1 7 およびその間に装着された軸受ボール 7 によって上下 2 列のアンギュラ玉軸受からなる主軸受が構成されている。その結果、ころ 1 2 を介して内側リング（内接円筒 6）と連結された外側リング（出力軸 8）は、ケース 1 7 に対して回転可能である。

【 0 0 3 0 】

ケース 1 7 は前述したフレーム 1 1 上にピンまたはキー 1 5 により固定されている。一方、外側リング（出力軸 8）はフランジ 9、ボルト 1 8 を介して前述したテーブル 1 0 に取着されている。なお、符号 1 9 は隣接する中間軸 2 の間に設けられた支持部材であり、キャリア 4 の剛性を高めている。

【 0 0 3 1 】

上記の構成からなる本発明の実施例においては、内接円筒 6 および外接軸 5 は

リング状中空円筒であり、弾性域内において自由変形できるように浮動している構造、すなわち軸受の支持がない状態で中間軸 2 により保持されている。なお、リング状の中空円筒からなる外接軸 5 および内接円筒 6 の寸法、材質は中間軸 2 に外接または内接して所望の圧接力を生じるとともに繰返し応力により疲労しないように適宜選定している。

【 0 0 3 2 】

すなわち、外接軸 5 は一方の浮動リングとして作用するので、この浮動リング（中空外接軸 5）は自由状態の外径が中間軸 2 に外接する円の直径より若干大きく形成されている。この浮動リングを複数の中間軸 2 に外接するように中心に組み込む。これにより、真円であった浮動リング（中空外接軸 5）の形状は、その弾性域において波状に変形して圧接力を発生する。なお、この場合に、浮動リングの変形により生じる波の数は、中間軸 2 の数に等しくなる。

【 0 0 3 3 】

また、内接円筒 6 を他方の浮動リングとしており、この浮動リング（中空リング状内接円筒 6）の自由状態の内径は、複数の中間軸 2 が内接する円の直径より若干小さく形成されている。複数の中間軸 2 が浮動リングに内接するように、この浮動リングを中間軸 2 の外側に組み込んでいる。

【 0 0 3 4 】

駆動モータ 1 を回転させると、その出力軸 1 a の回転が中間軸 2 に伝えられ、中間軸 2 の回転はトラクション力によって内接円筒 6 に伝えられ、内接円筒 6 と中間軸 2 との半径比で中間軸 2 のトルクが増大される。この場合に、本実施例では歯と歯の噛合いがないのでスムーズな減速回転が実現できる。

【 0 0 3 5 】

また、図 2 に示すように中間軸 2 に対して外接円筒（外接軸）5 が突張る荷重と内接円筒 6 の絞る荷重とをつり合わせて中間軸 2、外接円筒（外接軸）5 および内接円筒 6 の間をバランス状態に保ち、内部の加圧荷重が中間軸 2 を支持するベースや主軸受に余計なアンバランス力、或いは変形を与えないために装置全体の振動と騒音を著しく減少する。

【 0 0 3 6 】

更に、最内側中央の外接軸 5 の変形による圧接力が中間軸 2 および内接円筒 6 に作用し、内接円筒 6 が振れてその回転精度が低下する心配の対策として、本実施例においては、内接円筒 6 が同心状の二重中空リングからなり、二重中空リングの内側リング 6 と外側リング 8 とが連結部材（ころ 1 2）により連結されていてもよい。これにより、リング状の中空円筒からなる外接軸 5 の変形に起因する該内側リングの変形が外側リングに伝わり難くなり、内接円筒 6 の回転精度が向上する

すなわち、トラクション力を得るための加圧荷重がベースとケーシングに伝わらないので、主軸受をトラクション機構の近くに配置しても、主軸受の回転精度に悪影響を及ぼすことなく、扁平型の駆動装置が得られる。

【 0 0 3 7 】

更に、電気モータは減速機の回転軸中心からモータ半径より大きくオフセットして配置し中空構造を設けた。その中空構造部にテーブルの温度を制御するためのジョイントを通すことによって温度制御が簡単にできる。

【 0 0 3 8 】

テーブルの回転主軸受の内外輪はそれぞれ出力軸のケーシングと一体であり、厚い肉厚で高精度、高剛性を実現することができる。

【 0 0 3 9 】

以上のことで大きな出力トルクと高い回転速度精度があり、且つ、低振動、低騒音で、中空構造を有するコンパクトで軽量のポリッシングテーブル、CMP（化学的機械的ポリッシング）用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置が提供され、すなわち、従来よりコンパクトで優れた回転安定性を持つポリッシング装置の回転駆動装置が実現できる。

【 0 0 4 0 】

本発明の別の実施例を次に説明する。図 3 は、本発明を CMP テーブルに適用した別の実施例の断面図であり、図 4 は図 3 に用いられているトラクション減速機の拡大断面図、図 5 は図 4 の 5 - 5 断面を示す。

【 0 0 4 1 】

図 3 において、テーブル 1 0 は円板状をしており、その上に半導体のウエーハ

や液晶ガラス等が載置され、上からポリッシャ（図示せず）で押圧されて、ウェーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いられる。符号 1 1 はフレームを示す。

【 0 0 4 2 】

テーブル 1 0 の中心部から中空軸 1 0 a が下向きに突出している。中空軸 1 0 a とフレーム 1 1 の開口 1 1 a との間にラジアル軸受 2 1 が装着され、またテーブル 1 0 の下面とフレーム 1 1 の上面との間にスラスト軸受 2 2 が装着されている。テーブル 1 0 は、ラジアル軸受 2 1 およびスラスト軸受 2 2 を介して、フレーム 1 1 の上に垂直軸の回りに回転可能に載置されている。

【 0 0 4 3 】

フレーム 1 1 の内部には、その開口 1 1 a の中心から偏心した位置に、トラクションドライブ減速機 2 0 が設けられ、トラクションドライブ減速機 2 0 には駆動モータ 1 が連結されている。

【 0 0 4 4 】

前述したフレーム 1 1 の中空軸 1 0 a の下端部に中空プーリ 1 0 b が形成され、トラクションドライブ減速機 2 0 の出力軸 2 3 に中実プーリ 2 4 が取着され、中空プーリ 1 0 b と中実プーリ 2 4 との間に歯付きベルトのような伝導部材 2 5 が係合されている。従って、テーブル 1 0 は、駆動モータ 1 からトラクションドライブ減速機 2 0 および伝導部材 2 5 を介して水平面内で回転可能である。

【 0 0 4 5 】

なお、トラクションドライブ減速機 2 0 の設置位置の偏心量は、トラクションドライブ減速機 2 0 の半径または駆動モータ 1 の半径のうち大きいものより、大きくしており、フレーム 1 1 の開口 1 1 a の下方が開いた状態として、このテーブル 1 0 の中空軸 1 0 a 内にジョイント 3 を通し、ポリッシングテーブル、CMP 用テーブルまたはポリッシャの温度を制御可能としている。

【 0 0 4 6 】

本実施例のトラクションドライブ減速機 2 0 の詳細を図 4 および図 5 を参照して説明する。駆動モータ 1 の出力軸 1 a に外接軸 5 がスプライン結合 2 6 され、外接軸 5 は出力軸 1 a と同軸上に位置している。

【 0 0 4 7 】

一方、トラクシヨンドライブ減速機 2 0 の出力軸 2 3 は下端部 2 3 a が円板状となっている。また、キャリア 4 も円板状となっている。出力軸 2 3 の円板状下端部 2 3 a と円板状キャリア 4 はボルト 3 1 により一体的に連結されている。トラクシヨンドライブ減速機 2 0 の外接軸 5 は、上下の軸受 4 1 を介して、上述の如く一体的に連結された出力軸 2 3 およびキャリア 4 に回転可能に支承されてトラクシヨンドライブ減速機 2 0 の回転中心に位置している。

【 0 0 4 8 】

出力軸 2 3 の円板状下端部 2 3 a には、その中心の周囲に複数（図 5 では 3 個）の孔 2 3 b が等配的に形成されている。中間軸支持軸 2 a の頭部が孔 2 3 b に挿入され、中間軸支持軸 2 a の下端がボルト 3 2 によりキャリア 4 に固定されており、出力軸 2 3 とキャリア 4 との間において、外接軸 5 の周囲に複数（図 5 では 3 個）の中間軸支持軸 2 a が等配的に配置されている。中間軸支持軸 2 a に軸受 1 3 を介して中間軸 2 が回転可能に支承されており、各中間軸 2 は軸 5 に外接している。

【 0 0 4 9 】

複数の中間軸 2 の外周が、内接円筒 6 の内周面に内接している。本実施例においては、内接円筒 6 は支持部材 1 1 a を介してフレーム 1 1 に固定されている。前述したように一体的に連結された出力軸 2 3 およびキャリア 4 は、上下の軸受 4 2 を介して支持部材 1 1 a の内側に回転可能に支承されている。

【 0 0 5 0 】

上述したスプライン結合 2 6 と下側の軸受 4 1 との間において、外接軸 5 と駆動モータカバー 1 b との間にオイルシール 5 1 が設けられている。また、オイルシール 5 1 の半径方向外側の駆動モータカバー 1 b に凹部 1 c が形成されて、トラクシヨンドライブ減速機 2 0 内で発生する摩耗粉の貯溜部が形成されている。なお、5 2 は着脱可能なボルトであり、ボルト 5 2 を外して貯溜凹部 1 c に溜まった摩耗粉を除去可能としている。

【 0 0 5 1 】

オイルシール 5 1 を損傷することなく摩耗粉が貯溜凹部 1 c へ移行するように

するために、下側の内側軸受 4 1 をシール付き軸受とするとともに下側の外側軸受 4 2 をシールなし軸受としてもよいし、図 6 (a) に示すように両軸受 4 1、4 2 をシールなし軸受とするとともにキャリア 4 に摩耗粉通過用の孔 4 a を形成してもよい。更に、図 6 (b) に示すようにキャリア 4 に摩耗粉通過用の孔 4 a を形成するとともに、下側の内側軸受 4 1 をシール付き軸受とし下側の外側軸受 4 2 をシールなし軸受としてもよいし、または、図 6 (c) に示すように両軸受 4 1、4 2 をシール付き軸受としてもよい。

【0052】

本実施例においては、駆動モータ 1 の出力軸 1 a の回転はトラクションドライブ減速機 2 0 の外接軸 5 に伝達される。この際に、内接円筒 6 がフレーム 1 1 に固定されているため、外接軸 5 の回転がトラクションドライブ減速機 2 0 の中間軸 2、内接円筒 6 を経て減速されて出力軸 2 3 に伝達される。出力軸 2 3 に取着された中実プーリ 2 4 から歯付きベルトのような伝導部材 2 5 を経て中空プーリ 1 0 b に回転が伝達され、テーブル 1 0 は水平面内で回転される。

【0053】

以上のことにより、大きな出力トルクと高い回転速度精度があり、且つ、低振動、低騒音で、中空構造を有するコンパクトで軽量のポリッシングテーブル、CMP（化学的機械的ポリッシング）用テーブルまたはポリッシャの回転駆動装置が提供され、すなわち、従来よりコンパクトで優れた回転安定性を持つポリッシング装置の回転駆動装置が実現できる。

【0054】

以上の実施例においては、本発明を CMP（化学的機械的ポリッシング）用テーブルの回転駆動装置に適用した実施例につきの説明したが、本発明は、CMP 用テーブルに限られず、広くポリッシングテーブルやポリッシャの回転駆動装置に適用することができる。

【0055】

【発明の効果】

本発明によれば、CMP テーブルの回転トルクの増大に伴う研磨の圧力の向上によって、スループット数を増大させ生産性を向上させる効果があり、また、テ

ーブルの下に簡単に完全に納まるコンパクト化で設置面積を削減できる。軽量化で耐荷重が比較的低いクリーンルーム床へ圧迫を軽減できるとともに、低コストが実現される。優れた回転の安定性がウエーハの均一平坦化に大きく寄与し、CMPテーブル駆動装置の性能を著しく向上させる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明をCMPテーブルに適用した一実施例の断面図である。

【図 2】

図 1 の 2-2 断面を示す。

【図 3】

本発明をCMPテーブルに適用した別の実施例の断面図である。

【図 4】

図 3 の実施例のトラクションドライブ減速機の拡大断面図である。

【図 5】

図 4 の 5-5 断面を示す。

【図 6】

(a) ~ (c) は更に異なるトラクションドライブ減速機の実施例の部分断面図である。

【符号の説明】

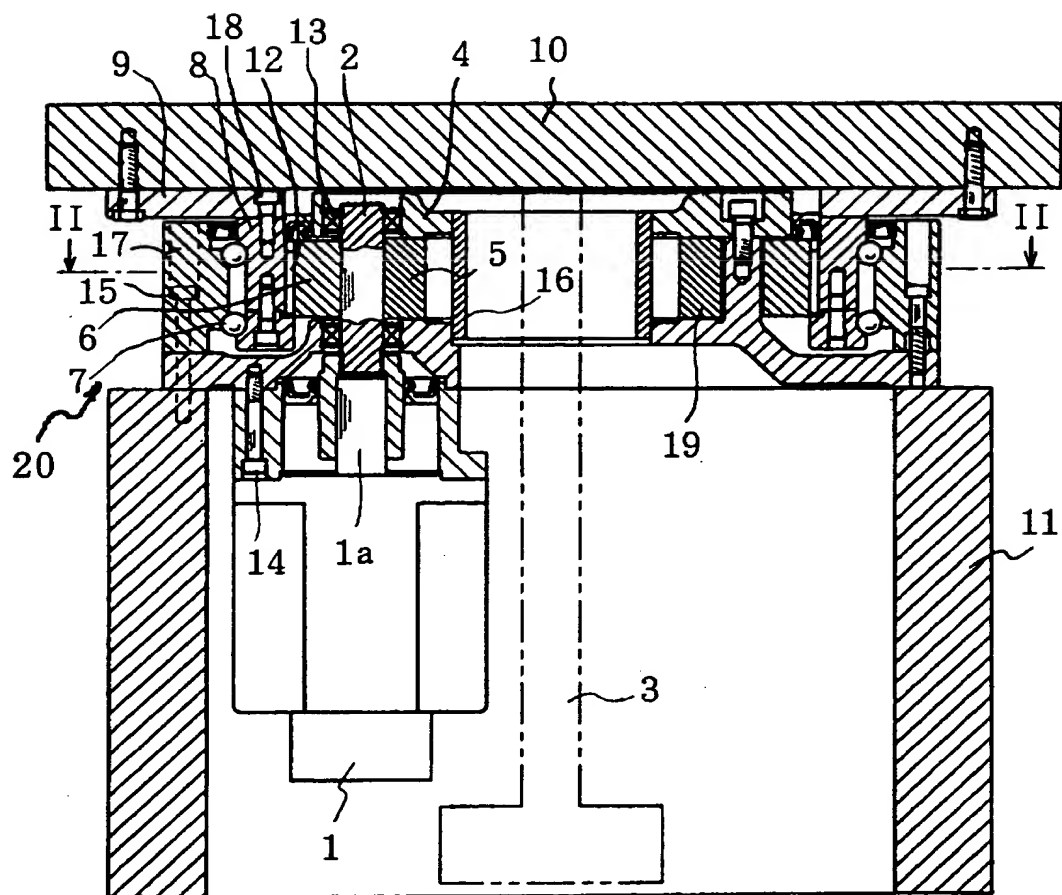
- 1 駆動モータ
- 1 a 出力軸
- 2 中間軸
- 3 ジョイント
- 4 キャリア
- 5 外接軸
- 6 内接円筒
- 8 出力軸
- 9 フランジ
- 10 テーブル

- 10 a 中空軸
- 10 b 中空プーリ
- 11 フレーム
- 12 ころ
- 13 軸受
- 14 ボルト
- 15 ピンまたはキー
- 16 薄肉円筒
- 17 ケース
- 23 出力軸
- 24 中実プーリ
- 25 歯付きベルト

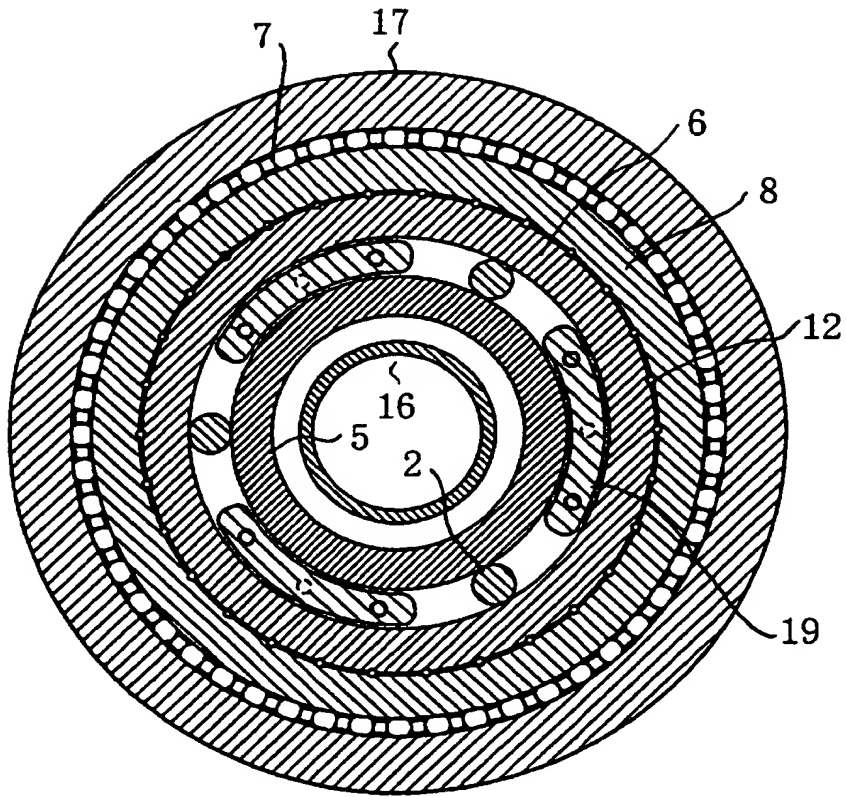
【書類名】

図面

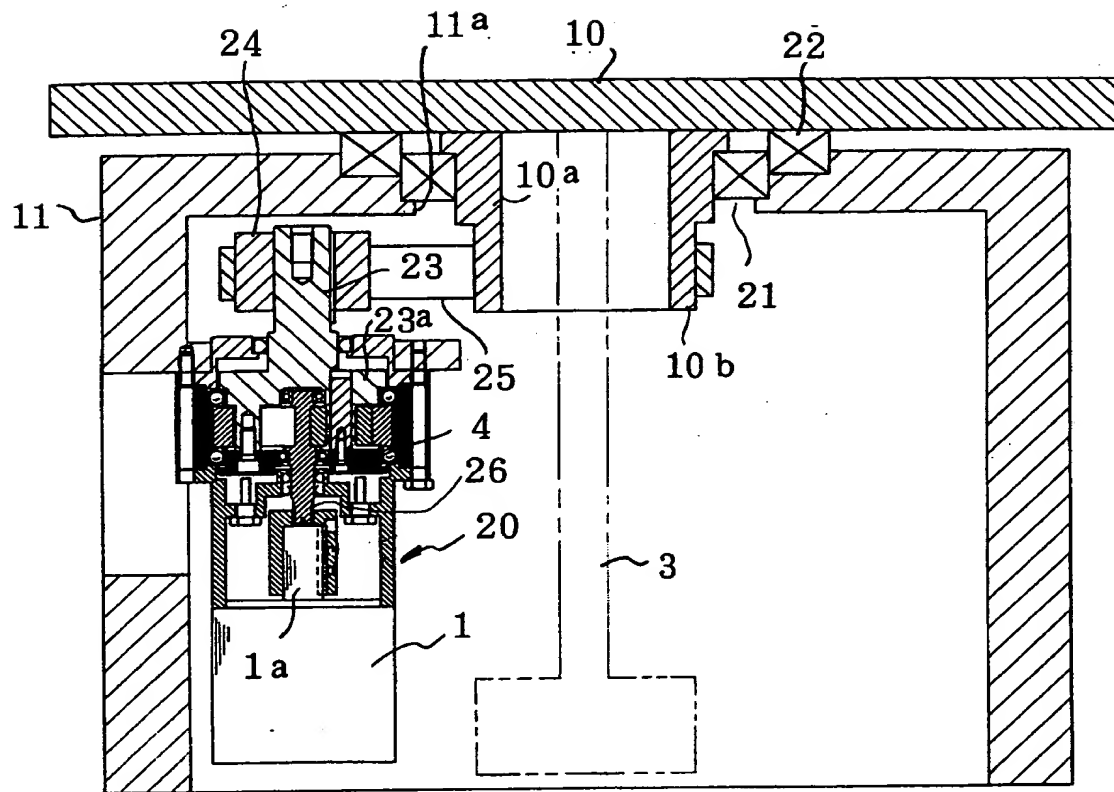
【図1】



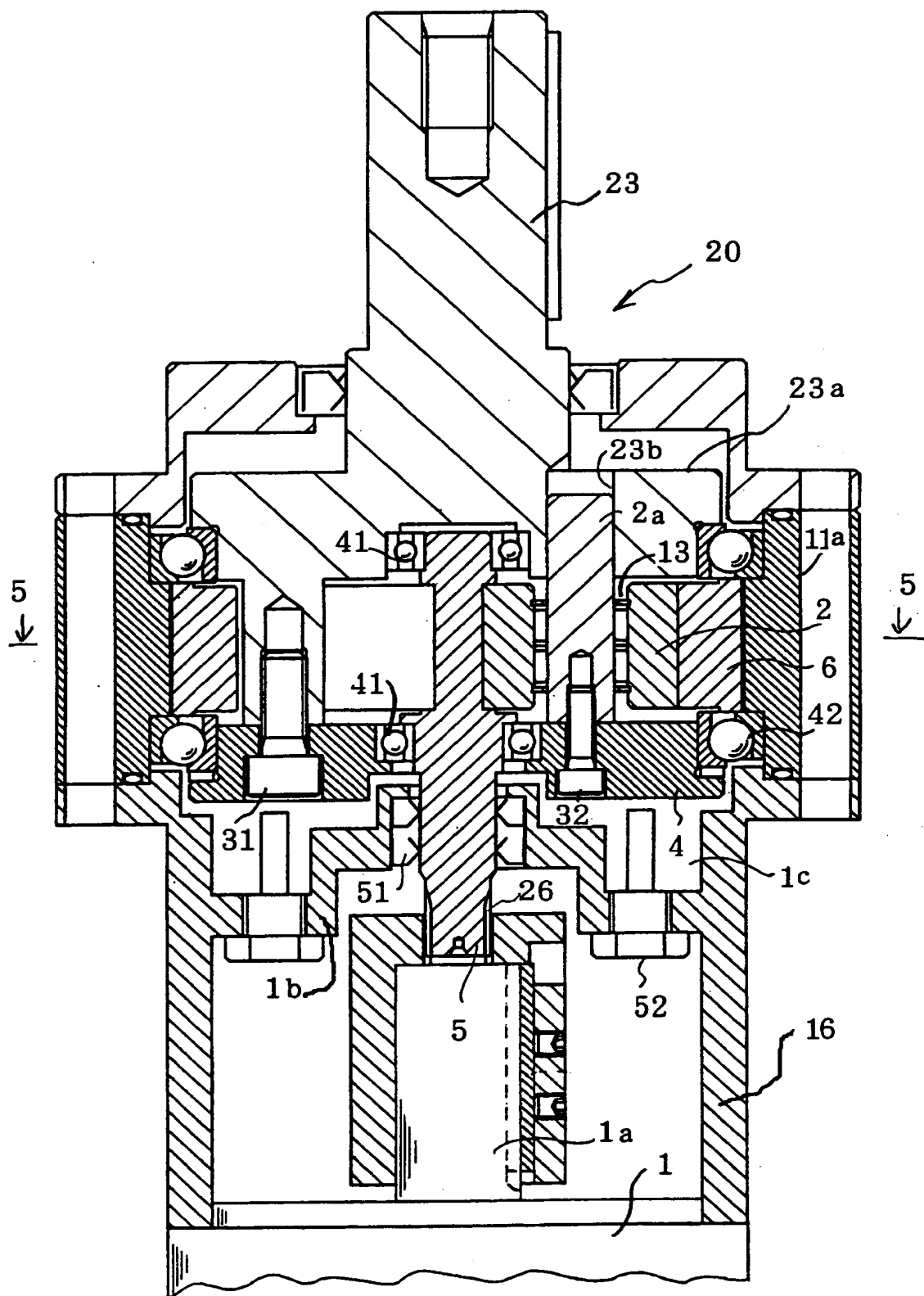
【図 2】



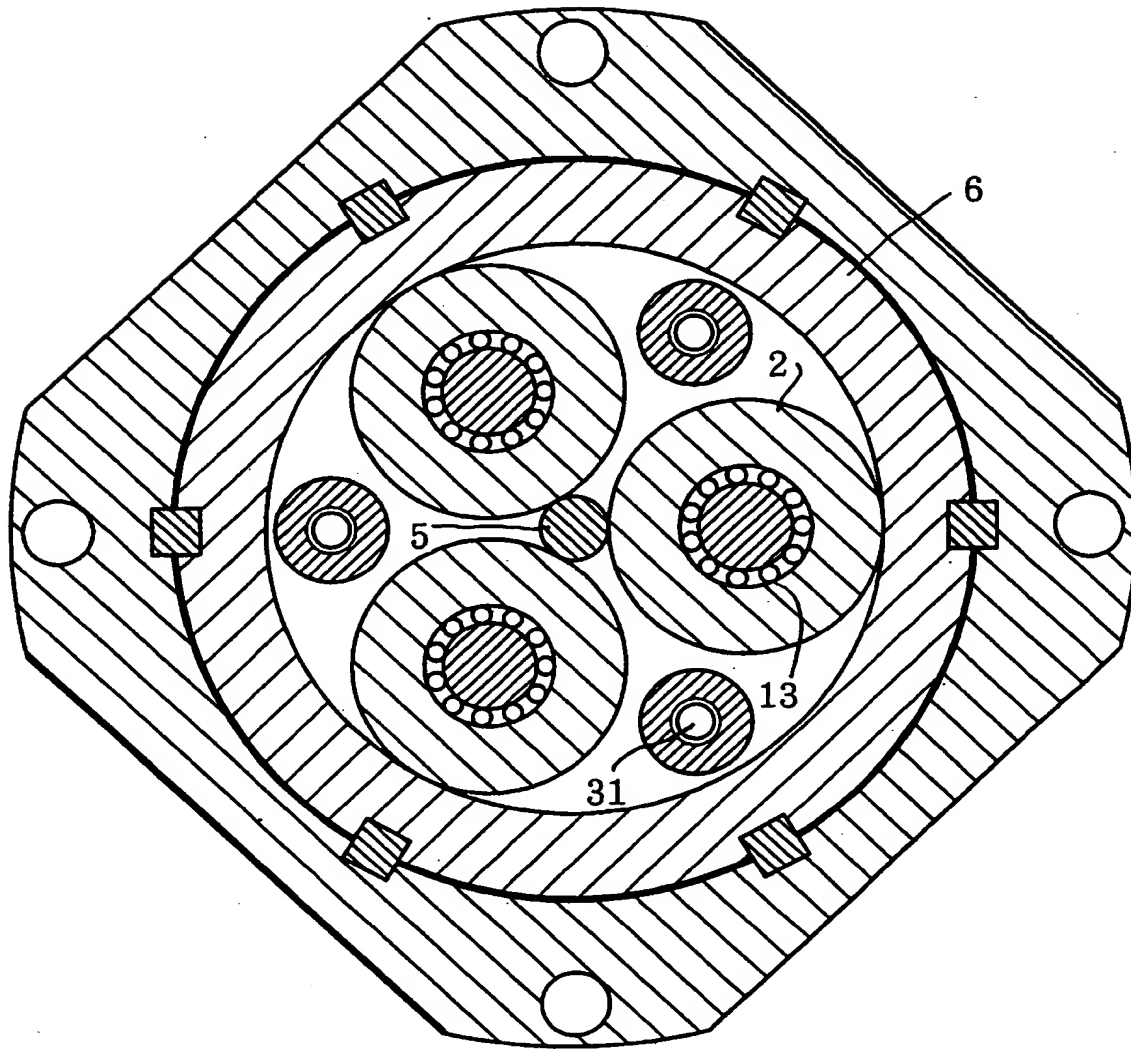
【図3】



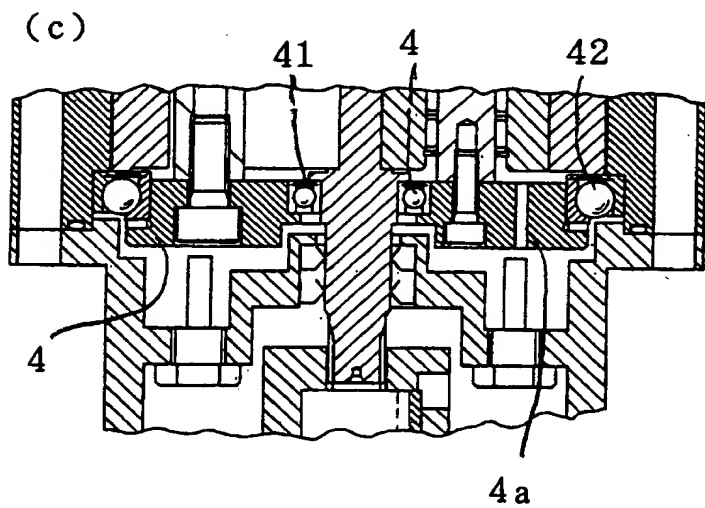
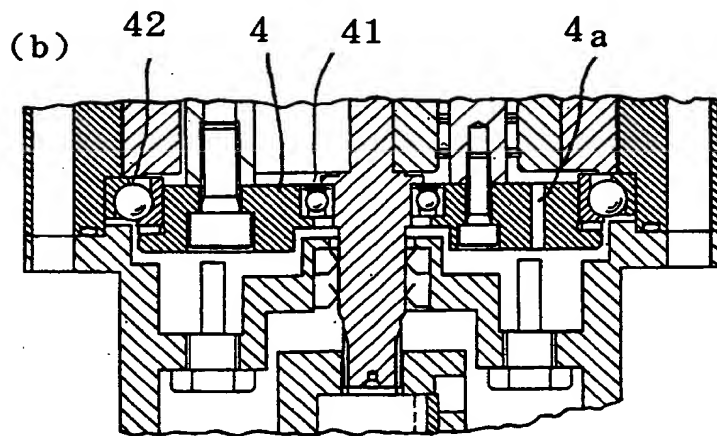
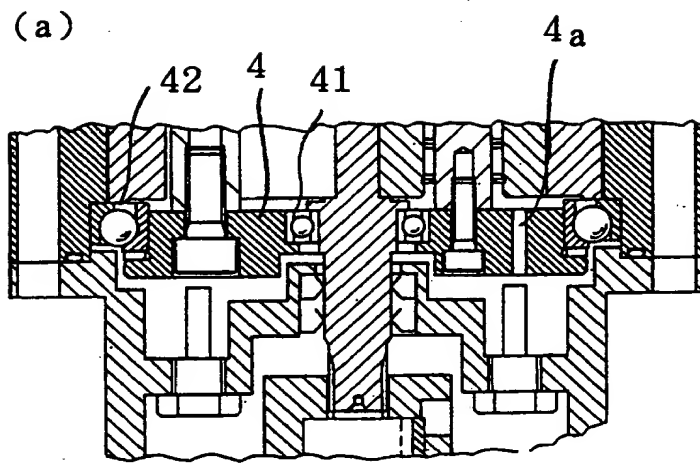
【図 4】



【図5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 大きな出力トルクと高い回転速度精度を有し、且つ、低振動、低騒音で、更に中空であるコンパクトで、軽量のポリッシング、CMP用テーブルまたはポリッシャの駆動装置を提供する。

【解決手段】 半導体のウエーハの端面や液晶ガラスの端面等を平坦化するために用いるポリッシングテーブル、CMP用テーブル10またはポリッシャの回転駆動装置において、リング状の中空円筒からなる外接軸5が中心に配設され、外接軸の周囲に複数の中間軸2が等配的に配置されて外接軸に外接するとともに中間軸の少なくとも1本が入力軸となっており、中間軸が内接する内接円筒からなり、リング状の中空円筒からなる外接軸は特別な支持ベアリングを設けることなく中間軸によって保持されて浮動リングとなっており、中空円筒外接軸は自由状態の外径が複数の中間軸に外接する円の直径より若干大きく形成されていて中空円筒の変形によって圧接荷重を発生するようになっており、内接円筒がポリッシングテーブル、CMP用テーブルまたはポリッシャに連結されている。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000215903]

1. 変更年月日	1999年10月 4日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都港区西新橋三丁目3番1号
氏 名	帝人製機株式会社